

Title (en)

ORGANOALUMINIUM, ORGANOGLASSUM AND ORGANOINDIUM COMPOUNDS AND THEIR USE FOR THE GAS-PHASE DEPOSITION OF METAL ON SUBSTRATES.

Title (de)

ALUMINIUM-, GALLIUM-, ODER INDIUM-ORGANISCHE VERBINDUNGEN UND IHRE VERWENDUNG ZUR GASPHASENABScheidung DES METALLS AUF SUBSTRATEN.

Title (fr)

COMPOSES ORGANIQUES D'ALUMINIUM, GALLIUM OU INDIUM ET LEUR UTILISATION POUR LE DEPOT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR DU METAL SUR DES SUBSTRATS.

Publication

**EP 0399021 A1 19901128 (DE)**

Application

**EP 90900116 A 19891127**

Priority

DE 3841643 A 19881210

Abstract (en)

[origin: WO9006315A1] The invention relates to organometallic compounds which are intramolecularly stabilized and have a cyclic or bicyclic structure, and their use to produce thin films and epitactic layers by gas-phase deposition. The invention concerns an organometallic compound of the formula (I) where M is aluminium, indium or gallium, Y is -NR<3>R<4>, PR<3>R<4>, -AsR<3>R<4>, -SbR<3>R<4>, -F or a perfluoroalkyl group with 1-7 C-atoms and the symbols R<1>, R<2>, R<3>, R<4> and X are as defined in claim 1.

Abstract (fr)

Composés organométalliques à stabilisation intramoléculaire et à structure cyclique ou bicyclique, et leur utilisation pour obtenir des couches minces et des couches épitaxiales par dépôt chimique en phase vapeur. Ces composés organométalliques correspondent à la formule (I), où M représente aluminium, indium ou gallium, Y représente -NR<sub>3</sub>R<sub>4</sub>, -PR<sub>3</sub>R<sub>4</sub>, -AsR<sub>3</sub>R<sub>4</sub>, -SbR<sub>3</sub>R<sub>4</sub>, -F ou un groupe perfluoralkyle avec 1 à 7 atomes de C, les symboles R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> et X ayant les significations indiquées dans la revendication 1.

IPC 1-7

**C07F 5/00; C07F 5/06; C23C 16/18; C23C 16/20**

IPC 8 full level

**C07F 5/00** (2006.01); **C07F 5/06** (2006.01); **C07F 9/50** (2006.01); **C07F 9/70** (2006.01); **C07F 9/90** (2006.01); **C23C 16/18** (2006.01); **C23C 16/20** (2006.01); **C23C 16/30** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

**C07F 5/00** (2013.01 - EP KR US); **C07F 5/062** (2013.01 - EP US); **C23C 16/18** (2013.01 - EP US); **C23C 16/20** (2013.01 - EP US); **C23C 16/301** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 9006315A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

**WO 9006315 A1 19900614**; DE 3841643 A1 19900613; DE 3841643 C2 19990701; EP 0399021 A1 19901128; JP 2824810 B2 19981118; JP H03502457 A 19910606; KR 910700254 A 19910314; US 5099044 A 19920324

DOCDB simple family (application)

**EP 8901431 W 19891127**; DE 3841643 A 19881210; EP 90900116 A 19891127; JP 50054290 A 19891127; KR 900701691 A 19900804; US 54887290 A 19900716